

О ВЛИЯНИИ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЦИЮ ТЕРМОДОНОРОВ И ПРЕЦИПИТАЦИЮ КИСЛОРОДА В КРЕМНИИ ПРИ 650 °С

В. Б. Неймаш, Ю. В. Помозов, В. И. Шаховцов, А. Н. Кабалдин,
В. М. Цмоць

Институт физики Академии наук Украины, 252650, Киев, Украина
(Получена 17 февраля 1993 г. Принята к печати 8 апреля 1993 г.)

Методами ИК спектроскопии и эффекта Холла исследовано влияние предварительного нейтронного облучения (ПНО) на преципитацию примеси кислорода и генерацию термодоноров (ТД) в монокристаллическом кремнии при 650 °С. Показано снижение эффективности влияния ПНО на генерацию ТД и распад твердого раствора кислорода с ростом флюенса. Обнаружено замедление накопления ТД при комбинированном введении дополнительных центров распада радиационной и термической природы. Полученные результаты интерпретируются с учетом аннигиляции радиационных дефектов в ходе ПНО и неоднородного распределения примеси кислорода в исходном Si.

Введение

Влияние радиационных дефектов на преципитацию примеси кислорода (O_i) в кремнии исследовалось многими авторами [^{1–4}]. Однако накопленных экспериментальных результатов еще недостаточно для однозначной интерпретации наблюдаемых зависимостей, особенно в области температур 600–800 °С. Между тем получение такой информации необходимо для понимания природы термодефектов, образующихся в этом температурном интервале в результате преципитации O_i . Это относится, в частности, к так называемым «вторым термодонорам» (ТД-2). Поэтому целью настоящей работы было изучение влияния предварительного нейтронного облучения (ПНО) на распад пересыщенного твердого раствора кислорода и генерацию ТД-2.

Эксперимент

Образцы промышленного n -Si, полученного методом Чохральского ($\rho = 75$ Ом·см, $N_O = 1 \cdot 10^{18}$ см⁻³, $N_C < 5 \cdot 10^{16}$ см⁻³), подвергались нейтронному облучению (кадмивое число 10) в интервале доз $1 \cdot 10^{16}$ – $5 \cdot 10^{18}$ см⁻² при $T < 100$ °С. После облучения эти образцы вместе с контрольными подвергались термообработке (ТО) при $T = 650$ °С на воздухе, длительность ТО составляла 0.5–206 ч. По интенсивности полосы ИК поглощения при 1100 см⁻¹ контролировалось изменение концентрации межузельного кислорода O_i , а по температурным зависимостям постоянной Холла – накопление ТД.

Результаты и обсуждение

Одним из результатов преципитации кислорода в Si является образование кислородных ТД. На рис. 1 показана кинетика изменения концентрации свободных электронов в ходе генерации ТД при 650 °С в образцах, подвергнутых различным флюенсам предварительного облучения. Видно, что начальная скорость изменения концентрации носителей тока в облученных образцах приблизительно на 2 порядка, а максимальная их концентрация — на порядок выше, чем в контролльном материале. Характерно, что выход концентрации носителей тока в насыщение происходит за приблизительно одинаковое время — около 100 ч независимо от флюенса.

Изменение концентрации свободных носителей Δn обусловлено не только генерацией ТД, но и возникновением дополнительных доноров — атомов фосфора вследствие нейтронно стимулированной трансмутации атомов Si, т. е. $\Delta n = N_{TD} + N_p$. Вклад фосфора в Δn определялся нами путем отжига ТД при 900 °С в течение 30 мин.

С учетом роли атомов фосфора оказалось, что вклад ТД в Δn уменьшается с ростом флюенса облучения.

Для характеристики эффективности введения дополнительных (по сравнению с контролльным материалом) ТД мы использовали параметр $\Delta N_{TD}^{\max}/\Phi$, где $\Delta N_{TD}^{\max} = N^i - N^0$, N^i — максимальная концентрация ТД в облученном, N^0 — в контролльном материале, Φ — флюенс ПНО.

На рис. 2 показана зависимость параметра $\Delta N_{TD}^{\max}/\Phi$ от флюенса облучения. Видно, что чем больше флюенс предварительного облучения, тем меньше его «удельное» стимулирующее влияние на генерацию ТД. Причем это уменьшение начинается уже с доз более $1 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Этот результат, на наш взгляд, противоречит представлениям о том, что ТД-2 (как комплексы SiO_m) образуются в результате растворения комплексов SiO_m , где $m > n$. Действительно, предположим, что роль ПНО сводится к образованию SiO_m -комплексов в областях разупорядочения (как это предполагается в работе [1]). Тогда снижение эффективности накопления ТД-2 с ростом флюенса нейтронов было бы возможно лишь за счет

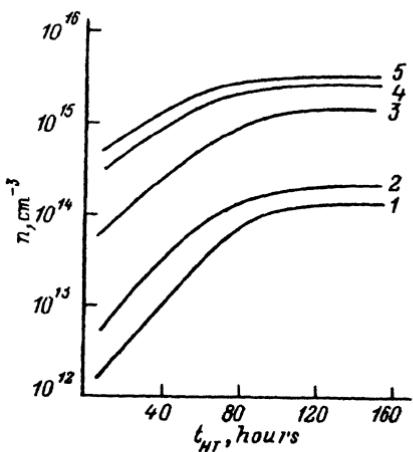


Рис. 1. Зависимости концентрации свободных электронов от длительности ТО при 650 °С в образцах, подвергнутых различным флюенсам облучения.

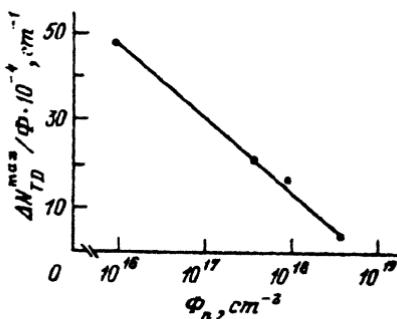


Рис. 2. Зависимость параметра $\Delta N_{TD}^{\max}/\Phi$ от флюенса облучения.

истощения доли кислорода, находящегося в растворенном состоянии, из-за перехода существенной его части в состав таких комплексов. Однако, как видно из рис. 3, даже после максимального флюенса основная часть кислорода находится в межузельном состоянии.

С точки зрения представления о ТД как промежуточных этапах преципитации в виде растущих комплексов SiO_n (где $k < n < m$) полученные результаты свидетельствуют о том, что введенные облучением радиационные дефекты, по-видимому, играют роль дополнительных центров зарождения SiO_k ($k < n$), участвующих в формировании ТД-2.

Дополнительным аргументом в пользу этого могут служить результаты наших исследований влияния ПНО на распад твердого раствора кислорода при 650°C , приведенные на рис. 3. Здесь показаны зависимости концентрации кислорода в растворенном (оптически активном) состоянии от длительности ТО при 650°C для образцов с различными флюенсами ПНО. Видно, что ПНО существенно стимулирует распад твердого раствора кислорода, сокращая длительность инкубационного периода (t_u^0) со 105 ч в контролльном до 20 ч в облученном флюенсом $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$ материале. Сокращение t_u^0 является характерным признаком введения дополнительных центров распада твердого раствора кислорода. Для характеристики эффективности влияния ПНО на сокращение t_u^0 используем параметр $\Delta t_u/\Phi = (t_u^0 - t_u^i)/\Phi$, где t_u^0 — длительность инкубационного периода в контролльном (необлученном); t_u^i — в облученном флюенсом Φ образце.

На рис. 4 приведена зависимость этого параметра от флюенса ПНО. Видно, что она имеет характер, аналогичный зависимости, приведенной на рис. 2, т. е. ПНО оказывает сходное влияние на генерацию ТД-650 и на введение дополнительных центров распада для твердого раствора кислорода. Исследованный нами интервал флюенсов ПНО ($1 \cdot 10^{16}$ — $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$) соответствует нелинейному участку дозовых зависимостей накопления радиационных дефектов. Это означает существенную роль непрямой аннигиляции компонентов пар Френкеля. Поэтому снижение эффективности введения зародышей для ТД-2 и центров распада для твердого раствора кислорода радиационного происхождения можно объяснить снижением эффективности накопления радиационных дефектов, обусловленное аннигиляцией на них компонентов пар Френкеля. Иными словами, роль до-

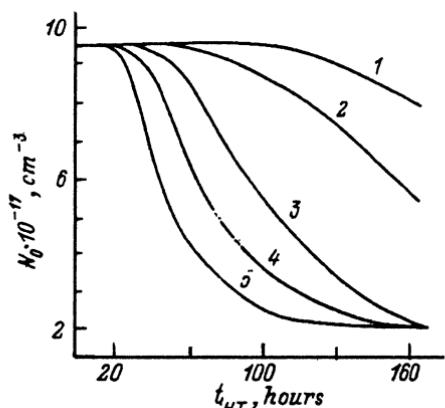


Рис. 3. Зависимости концентрации оптически активного кислорода от длительности ТО при 650°C для образцов с различными флюенсами предварительного нейтронного облучения.

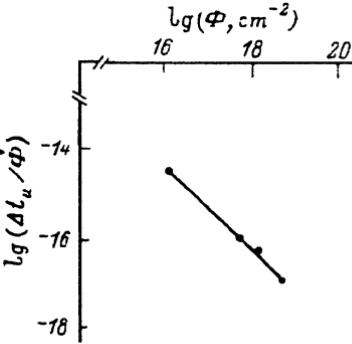


Рис. 4. Зависимость параметра t_u/Φ от флюенса предварительного нейтронного облучения.

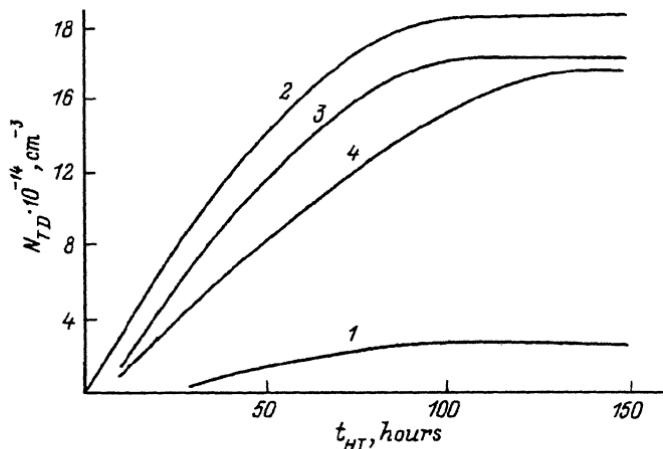


Рис. 5. Зависимости концентрации ТД-2 от длительности ТО при 650 °С для образцов: контрольного (1); прошедшего ПТО 450 °С, 100 ч (2); облученного $\Phi = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$ (3); облученного $\Phi = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$ и затем ТО при 450 °С, 100 ч (4).

полнительных зародышей для образования ТД-650 и центров распада для твердого раствора кислорода, по-видимому, играют термостабильные при 650 °С радиационные дефекты, в состав которых входит по крайней мере одна из компонент пар Френкеля. Эти же радиационные дефекты являются центрами аннигиляции для компонентов пар Френкеля при ПНО, вследствие чего эффективность их введения снижается с ростом флюенса ПНО.

Известно, что стимулирующее влияние на генерацию ТД-2 при 650 °С оказывает как введение радиационных дефектов в ходе ПНО, так и предварительное введение ТД-1 при 450 °С [5]. Для сравнения эффективности влияния на генерацию ТД-2 ПНО и предварительной ТО при 450 °С нами получены следующие результаты. На рис. 5 показаны зависимости концентрации ТД-2 от длительности ТО при 650 °С для образцов: контрольного (кривая 1); прошедшего предварительную ТО при 450 °С в течение 100 ч (кривая 2); облученного нейтронами при $\Phi = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$ (кривая 3); облученного при $\Phi = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$, затем термообработанного при 450 °С, 100 ч (кривая 4). Видно, что, во-первых, даже максимальный из использованных флюенсов ПНО приводит к меньшему росту $N_{\text{тд}}$, чем предварительная ТО при 450 °С. Во-вторых, дополнительные центры распада, введенные с помощью ПНО и предварительной ТО, вместе меньше стимулируют накопление ТД-2, чем будучи введенными раздельно. В-третьих, в случае комбинированного введения центров распада (ПНО + предварительная ТО) время выхода в стационар зависимости $N_{\text{тд}}(t_{\text{HT}})$ существенно увеличивается, тогда как для контрольных образцов и облученных во всем исследованном интервале флюенсов это время приблизительно одинаково (рис. 1).

Процесс накопления ТД-2 как промежуточных комплексов в ходе преципитации примеси кислорода в Si можно описать с помощью реакции образования ТД путем присоединения атома O_i к зародышу или центру распада (N) и реакции перехода ТД в электрически нейтральный комплекс (Si_mO_n , $m > n$) тоже при захвате O_i . При соблюдении условия $N_{\text{тд}} \ll N_N$ и $N_{\text{тд}} \ll N_O$ соответствующее кинетическое уравнение имеет вид

$$\frac{dN_{\text{тд}}}{dt} = \kappa_1 N_N N_O - \kappa_2 N_{\text{тд}} N_O, \quad (1)$$

где N_N — концентрация зародышей (или центров распада), N_O — концентрация кислорода, κ_1 и κ_2 — константы захвата атома O_i на зародыш и термодонор ТД соответственно.

Начальный (прямолинейный) участок кинетических кривых на рис. 5 описывается первым членом правой части уравнения (1), а стационарный ($dN_{\text{ТД}}/dt = 0$) соотношением

$$\kappa_1 N_N N_O = \kappa_2 N_{\text{ТД}}^{\max} N_O, \quad (2)$$

где $N_{\text{ТД}}^{\max}$ — максимальная концентрация ТД для данного образца.

Отсюда ясно, что увеличение начального темпа генерации ТД-2 и увеличение $N_{\text{ТД}}^{\max}$ обусловлено увеличением концентрации зародышей N_N . Причем даже при максимальном флюенсе N_N радиационной природы меньше, чем N_N , вводимых предварительной ТО при 450 °C. Уменьшение $dN_{\text{ТД}}/dt$ и $N_{\text{ТД}}^{\max}$ в образце с комбинированным введением зародышей по сравнению с раздельным можно объяснить тем, что уже в ходе ТО при 450 °C определенная часть центров распада радиационной природы перерастает размер, соответствующий зародышу для ТД-2. А гомогенное образование зародышей термической природы замедляется вследствие конкурирующего ухода атомов O_i на радиационные центры распада. Иными словами, радиационные центры зарождения играют роль, аналогичную той, что примесь углерода играет в процессе образования ТД-1 [6].

Особый интерес представляет факт увеличения времени выхода зависимости $N_{\text{ТД}}(t'_{\text{HT}})$ на стационарное значение в материале с комбинированным введением зародышей для ТД-2 по сравнению с другими материалами. Решение уравнения (1) имеет вид

$$N_{\text{ТД}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} N_N [1 - \exp(-\kappa_2 N_O t'_{\text{HT}})]. \quad (3)$$

Если в качестве критерия времени выхода зависимости $N_{\text{ТД}}(t'_{\text{HT}})$ на стационарное значение использовать время достижения 90% максимальной величины $N_{\text{ТД}}(t'_{\text{HT}})$, то из (3) этому соответствует условие

$$\exp(-\kappa_2 N_O t'_{\text{HT}}) \leq 0.1 \approx \exp(-2.3), \quad (4)$$

откуда

$$t'_{\text{HT}} \geq 2.3 / \kappa_2 N_O. \quad (5)$$

Следовательно, величина $t'_{\text{HT}} d$ определяется концентрацией N_O и ее увеличение для зависимости 4 на рис. 5 означает уменьшение N_O . Однако изменение ИК поглощения кислородом на $\lambda = 9.1$ мкм после предварительной ТО при 450 °C слишком мало, для того чтобы объяснить увеличение t'_{HT} уменьшением интегральной концентрации O_i .

Известно, что определенная часть примеси O_i в Si находится в виде «облаков», где ее концентрация существенно выше, чем в среднем по объему [7]. Вследствие этого ТД генерируются в первую очередь внутри таких облаков, образуя термодонорные скопления [8–10]. Учитывая это, увеличение t'_{HT} можно объяснить следующим образом. Введенные при ПНО дополнительные зародыши для ТД-2 распределены по кристаллу равномерно. Часть из них попадает в кислородные «облака», определяя генерацию ТД-2 на начальных этапах ТО. В случае предварительной ТО при 450 °C эти зародыши, по-видимому, успевают вырасти до размеров, превышающих размер зародыша для ТД-2, и при последующей ТО

при 650°C уже не участвуют в генерации ТД-2. В таком кристалле основной вклад в генерацию ТД-2 дают зародыши, находящиеся вне кислородных облаков, что эквивалентно уменьшению эффективной N_{O} и может привести к увеличению t_{HT} .

Выводы

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать следующие выводы.

1. Предварительное нейтронное облучение существенно ускоряет распад пересыщенного твердого раствора примеси кислорода в кремнии посредством создания термостабильных при 650°C радиационных дефектов, служащих дополнительными центрами распада. Причем эффективность введения таких радиационных дефектов снижается с ростом флюенса ПНО, что может быть обусловлено их участием в процессах аннигиляции компонентов пар Френкеля в ходе облучения.

2. Сопоставление экспериментальных кинетических зависимостей концентрации межузельного кислорода и ТД при различных флюенсах предварительного облучения нейtronами свидетельствует в пользу представлений о ТД-2 как растущих кислородосодержащих преципитатах.

3. Анализ кинетики накопления ТД-2 в Si с дополнительно введенными для твердого раствора кислорода центрами осаждения для радиационной и термической природы свидетельствует о существенной роли пространственно неоднородного распределения примеси кислорода в исходном кремнии для процессов распада твердого раствора кислорода и, в частности, для образования ТД-2.

Авторы благодарят А. Н. Крайчинского за полезное обсуждение настоящей работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] A. A. Groza, L. G. Nikolaeva, H. I. Starchik, G. G. Shmatko, I. I. Zaslavski. Phys. Stat. Sol., A70, 763 (1982).
- [2] Ю. М. Бабицкий, П. М. Гринштейн, М. А. Ильин. ФТП, 19, 2070 (1985).
- [3] J. L. Lindstrom, B. G. Svenson. Mater. Res. Sci. Symp. Proc., 59, 45 (1986).
- [4] В. П. Маркевич, Л. И. Мурин. ФТП, 25, 1737 (1991).
- [5] П. М. Гринштейн, Г. В. Лазарев, Е. В. Орлова, З. А. Сальник, В. А. Фистуль. ФТП, 12, 121 (1978).
- [6] J. Lerouxille. Phys. Stat. Sol. (a), 67, 177 (1981).
- [7] В. В. Воронков, Г. И. Воронкова, В. Л. Калинушкин, Т. П. Мурина, Т. Назаров, А. М. Прохоров, О. А. Ремизов, А. Т. Тешабаев. ФТП, 17, 1390 (1983).
- [8] В. Б. Неймаш, Т. Р. Саган, В. М. Цмоць, В. И. Шаховцов, В. Л. Шиндич. УФЖ, 36, 1398 (1991).
- [9] В. Б. Неймаш, Т. Р. Саган, В. М. Цмоць, В. И. Шаховцов, В. Л. Шиндич, В. С. Штым. ФТП, 25, 1864 (1991).
- [10] А. Н. Кабалдин, В. Б. Неймаш, В. М. Цмоць, В. И. Шаховцов, А. В. Батунина, В. В. Воронков, Г. И. Воронкова, В. П. Калинушкин. УФЖ, 38, 34 (1993).

Редактор В. В. Чалдышев